プラズマ処理による高分子材料の表面分子の回転について

安田 武*, 奥野 温子*, 吉田 恭子*

(武庫川女子大学家政学部被服学科)

H. Yasuda**

(州立ミズリーコロンビア大学化学工学科)

Surface Dynamics Stabilization by Plasma Polymerization

Takeshi Yasuda*, Tsumuko Okuno*, Kyoko Yoshida*

Department of Textiles and Mukogawa Women's University, Nisinomiya 663

Hirotsugu Yasuda**

University of Missouri-Columbia Columbia, MO 65212, U.S.A.

As demonstrated in Part II¹ of this series of studies, the hydrophobic character of CF4 plasma-treated Nylon 6 and poly(ethylene terephthalate) (PET) decay with time of water immersion, and the rate of decay can be used as a measure for the surface mobility of (substrate) polymers. The same method of using fluorine-containing moieties introduced by CF4 plasma treatment as surface labeling is applied to investigate the influence of a thin layer of plasma polymer of methane applied onto the surface of those polymers. An ultrathin layer of plasma polymer provides a barrier to the rotational and diffusional migration of the introduced chemical moieties from the surface into the bulk of the film. The influence of operational parameters of plasma polymerization on the surface dynamic stability are examined by measuring the decay rate constants for (subsequently) CF4 plsma-treated samples. The rate constant was found to decrease sharply with increasing value of plasma energy input manifested by J / kg monomer, and no decay was observed as the energy input reached a threshold value (about 6.5 GJ/kg for PET, about 7.0 GJ/kg for Nylon 6), indicating that unperturbable surfaces can be created by means of plasma polymerization.

1.緒言

前報において 2 ナイロン 6 および PET フィルムの表面に、 CF_4 プラズマ処理をしたものについて、表面の性質を検討し、水浸によって表面極性基がバルクに回転拡散する現象について報告した。それによると、高分子の回転と表面付近での回転は、 $A_t = A_0 t^{-k}$ によって計算されるパラメーター k の現象によって、ほぼ定量的に表すことができる。この式において、 A_0 は、表面特性を表すパラメーターであり、オリジナル

の試料の水接触角あるいは ESCA·Fis ピーク強度を示すものであり、At は t 時間水浸した試料のパラメーターの値に相当する.

CF4 プラズマ処理をしたナイロン6と PET フィルムの疎水基の水浸によるみかけ上の減少は, 主として, 水・ポリマー界面からのフィルムのバルク層へのフッ素原子団の回転および拡散移動によるものである。この現象は, 水浸によって減少した疎水基が, サンプルを熱処理すると回復するという事実によって強く支持された. 熱処理によって, Fis ピークのみならず水接触角もオリジナル値に近づく様に増大する. その現象性は, 高分子試料の結晶化度の関数であると考えられる. 安田ら³は, ポリマー表面の酸素プラズマ

^{*} 被服材料学第1研究室

^{**}州立ミズリーコロンビア大学

処理による親水性が,時間と共に減少する傾向を,あ らかじめ,メタンプラズマ処理を行った場合について 示した.

本報では、これらの事実に付け加えてメタンのプラ ズマバリヤー効果は、湿潤状態で疎水基の減少を引き 起こすのを防ぐこともできるということについて報告 する.

2. 試 料

試料として用いたナイロン 6 フィルムは,東洋合成フィルム㈱,厚さ 75μ ,無延伸,表面加工なしのものであり,ポリエチレンテレフタレートフィルム(以下PET フィルムとする)は,東レルミラー,2軸延伸,厚さ 50μ ,表面加工なしのものである。なお,試料の洗浄は,非イオン界面活性剤(スコアロール#400)2 g/ℓ で20分,リン酸二ナトリウム $2 g/\ell$ で10分,再びリン酸二ナトリウムで10分間行い,十分水洗をして一昼夜風乾させた後,シリカゲルを入れた真空乾燥器中で乾燥して保存した。

3. 実験方法

3. 1. CH4 プラズマ処理

ナイロン6フィルムおよび PET フィルムのメタンプラズマ処理は、米国ミズリー大学材料研究所に依頼して行ったものである。プラズマ装置は、ベルジャー型のもので、処理条件の大略は次のようである。

試料は 4×4 inch 大のフィルムをアルミニウムの 円盤に取り付け,試料フィルムの四隅を金属ネジで固定して,電極の中間におき,試料フィルム上に均一に 重合処理を行うため,一定の速度で試料盤を回転させた.重合物の厚さは,透明石英の反応器の厚さによって測定した.試料のコーティング厚さおよびグロー放電の条件は,Table 1(Nylon 6 フィルム),Table 2(PET フィルム)に示す通りである.

3. 2. CF4 プラズマ処理

プラズマ装置は, IPC-1001-148AN (International Plasma 社)を用いた. 反応容器の内容積は2035ml, 周波数13.56MHz のものを用い,電極は反応容器の外部

Table. 1 Conditions of plasma polymerization of CH₄ applied on Nylon 6 films

Sample	W	Flow rate	Po	Pg	Thickness (on T.M.)	W/FM
Sample	(Wattage)	(SCCM)	(mtorr)	(mtorr)	(nm)	$(\times 10^{10} \text{J/kg})$
Nylon 6/M-1	75	6.30	56.1	65.1	60	0.10
Nylon 6/M-2	75	2.52	31.0	34.7	60	0.25
Nylon 6/M-3	75	1.58	24.0	29.6	60	0.40
Nylon 6/M-4	75	1.15	18.5	23.5	60	0.55
Nylon 6/M-5	75	0.90	15.4	20.2	60	0.70

Table. 2 Conditions of plasma polymerization of CH4 applied on PET films

C1	W	Flow rate	Po	Pg	Thickness	W/FM
Sample	(Wattage)	(SCCM)	(mtorr)	(mtorr)	(on T.M.) (nm)	$(\times 10^{10} \text{J/kg})$
PET/M-1	85.17	4.36	43.6	46.3	120	0.164
PET/M-2	85.74	1.47	20.4	18.7	120	0.494
PET/M-3	84.15	0.48	9.22	7.2	120	1.473
PET/M-4	85.16	4.43	43.3	45.8	60	0.161
PET/M-5	85.78	1.42	20.2	19.0	60	0.506
PET/M-6	84.15	0.48	9.63	7.5	60	1.473

側面に対局した capacitive coupling で、いわゆる無電極グロー放電方式である。フィルムへのプラズマ処理は、 CF_4 ガスを用いて,放電電力150W,ガス流量50cm/min.,圧力1.5 Torr の条件で5分間処理を行った.

3.3.接触角の測定

協和接触角計(協和科学KK.)を用いて,試料のほぼ中心上に垂直に液滴調節器を固定し、1回に $2.7~\mu\ell$ ずつ水滴を滴下させて,同一箇所に20秒毎に5滴(合計 $13.56~\mu\ell$)まで滴下しながら接触角を測定した.なお、接触角は1滴から5滴までそれぞれ20秒毎に写真撮影を行い、そのフィルム上から角度を読みとった.

3. 4. ESCA の測定

ESCA の測定には、島津 X線光電子分析装置 ESCA 750 形を使用した.

試料は、 $6 \, \text{mm} \, \phi$, $10 \, \text{mm} \, \text{H} \, \text{O} \, \text{プローブチップの上面に }$ 両面接着テープで貼付し、プローブチップの大きさに 合わせてカットしたものを試料棒先端にねじ込み方式 で固定し、試料室に挿入した、照射X線はアルミニウム箔($2 \, \mu$)で沪光した $MgK \, \alpha \, X$ 線($8 \, \text{KV}$, $30 \, \text{mA}$)を用い、scan speed $2 \, \text{eV/sec}$, $X \, \text{軸感度} \, 20 \, \text{eV/cm}$, $Y \, \text{軸感度} \, 5 \, \text{Kcps/cm} \, 0 \, \text{条件 } \, \text{C} \, \text{760 eV} \sim 0 \, \text{eV} \, \text{O} \, \text{@}$ 囲の wide scan の測定を行った、また、 $O \, \text{Is}$, $O \, \text{Is}$, $O \, \text{Is}$ 、 $O \, \text{Is}$

3.5.水への浸漬方法

ナイロン6フィルムおよびナイロン6フィルムに、CH4 プラズマ処理を行ったもの、PET フィルムおよび PET フィルムに CH4 処理を行った試料について、CF4 ガスを導入してプラズマ処理を行い、その後、水浸して乾燥させた場合、水浸時間の変化によって表面に付着したF原子がどのように変化するのかを接触角及び ESCA を用いて検討した.

水浸処理の方法を, Fig. 1 に示す. 概要は次の通りである.

試料フィルムは、 6×4 cm大にとり、石英板の上に 平になるように置き、反応容器に入れて、CF4 ガス流量50cm/min、放電力150W,圧力1.5 Torr の条件で F 処理を行い、処理直後に一定の時間(1 , 5 , 30 , 60 , 90 , 120分)水浸し、ただちに液体窒素中で15分間凍結させて、その後凍結乾燥器中(-112℃)で乾燥した試料について、接触角と ESCA による F_{1s} 強度を測定した.

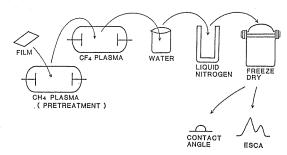


Fig. 1 Schematic representation of experimental procedures.

4. 実験結果

4.1.ナイロン6の場合

ナイロン6フィルムの前処理なしのもの(CH_4 処理を行っていないもの)と,種々の W/FM の条件で CH_4 処理をしたものとについて,一定条件で CF_4 処理を行ったものを水に浸漬した場合の接触角は, Table 3 ようになる.

Fig. 2 は、ナイロン 6 に CH4 処理していないものと、CH4 処理をしたものとについて、CF4 処理を行った後、一定時間水に浸漬をして、浸水時間に対して接触角をプロットしたものであるが、CH4 処理をしたものは、CH4 処理をしていない場合に比べて大きい値となっている。また、W/FM の大きい処理条件の場合には、この傾向が著しく、高い接触角を示している。そこで以上のことを更にはっきりとさせるために、CH4 処理条件の W/FM 値に対して接触角の値を、水に浸漬する前と後とについてプロットしてみると、Fig. 3 のようになり、W/FM 値が大きくなると、水に浸漬したときに接触角の変化が小さくなることが判る。これは、CH4 の重合によって、表面にネットワークが形成され、表面分子の回転、またはもぐり込みが困難になるためであろうと考えられる。

Fig. 2 に示した接触角の値を, 水に浸漬する前の値 に対する浸漬後の値を比で示すと, Fig. 4 のようになり, 判り易い.

また、Table 3 の水に浸漬した時間の対数に対して、接触角の対数値をプロットすると Fig. 5 のように直線関係で示され、 CH_4 処理なしのものに比べて大きい W/FM 値で CH_4 処理したもののほうが $\log \theta$ の値が大きくなり、直線の傾きも小さくなる。このことは、前に述べたように、 CH_4 による表面のネットワークの効果を示している。

一方,以上の接触角について検討したものと同様の

Table 3 Effects of CH₄ plasma polymerization on contact angle of water on CF₄ plasma treated Nylon 6 films immersed in water

		Contact angle(*)										
Submerged time (min)	Nylon 6 no pretreatment	Nylon 6/ M-1	Nylon 6/ M-2	Nylon 6/ M-3	Nylon 6/ M-4	Nylon 6/ M-5						
0	115.0	115.0	114.9	113.0	112.0	111.5						
5	102.0	100.5	102.5	104.5	107.0	115.5 (10min 118.3) (15mni 116.5)						
30	95.0	97.9	98.5	100.1	102.5	114.3						
60	92.0	93.1	94.7	95.5	100.3	111.3						
90	91.5	92.6	95.1	64.4	96.0	109.3						
120	89.6	90.8	93.6	93.0	94.0	111.3						
(No CF4 treatment	t 63.5	72.8	71.5	71.4	69.6	68.0)						

Table 4 Intensities of ESCA F_{1s} peaks of CF₄ plasma treated Nylon 6 films immersed in water

			ESCA F1s i	ntensity (cps×1	04)	
Submerged time (min)	Nylon 6 no pretreatment	Nylon 6/ M-1	Nylon 6/ M-2	Nylon 6/ M-3	Nylon 6/ M-4	Nylon 6/ M-5
0	8.16	8.08	8.01	7.96	7.75	6.53
5	7.09	6.96	7.24	7.42	7.33	6.90 (10min 6.93 (15min 6.92
30	6.47	6.50	6.83	7.10	6.88	6.68
60	6.20	6.37	6.72	7.01	6.42	6.65
90	6.59	6.19	6.25	7.01	7.23	6.69
120	6.05	6.27	6.57	6.95	7.20	6.57

試料を ESCA によって測定してみると, まず Fis ピーク強度については, Table 4のようになる. Table 4 の値を水に浸漬した時間に対してプロットしてみると, Fig. 6 のようになる. 見かけ上, 接触角のように明らかな差はないが, これは接触角が表面層のみの性質を示すことによるものであろう.

これらの実験結果を Fig. 3 と同様の形で示すと, Fig. 7 のようになり,W/FM 値が大きくなるほど,水 に浸漬した時の Fis ピーク強度の差が小さくなることがわかる.

Fig. 4 と同じように、Fis ピーク強度を水に浸漬する前の値に対する浸漬後の比で示すと、Fig. 8 のようになり、W/FM 値が大きいほど、水に浸漬する前の値

に近づくことがわかる.

Fig. 9 に示した ESCA シグナルによると、CH4 処理をしていないナイロン(A)に CF4 処理を行ったもの(B)は、CH2 が減少し、新たに CF3、CF2、CF に対応する高いピークが認められるが、これを水に浸漬すると(C)、Fに関するピークは低下し、一方、CH2 のピークが高くなる。このことは、ナイロンの CH2 に下が結合するが、これを水に浸漬すると、Fのついたセグメントは bulk 内部に移って、Fの結合していない CH2 のついたセグメントが表面に現われるものと考えられる。

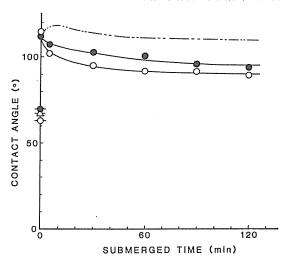


Fig. 2 Change of contact angle of water on CF₄ plasma treated Nylon 6 films as functions of water immersion time.

- -0- no treatment, CH₄ pretreatment $(M-4:W/FM~0.55\times10^{10}~J/kg)$,
- \leftarrow CH₄ pretreatment (M-5: W/FM 0.70×10^{10} J/kg)
- \circ CF4 treatment, \bullet CH4 pretreatment $(M\text{--}4:W/FM~0.55\times10^{10}~J/kg)~\&~CF_4~treatment,$
- --- CH₄ pretreatment (M-5:W/FM 0.70×10^{10} J/ kg) & CF₄ treatment.

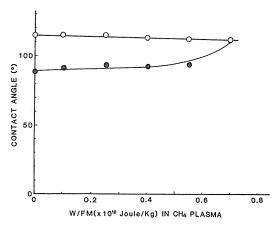


Fig. 3 Contact angles of water on unimmersed and water immersed samples of CF_4 plasma treated Nylon 6 films as functions of W/FM values of CH_4 plasma pretreatment.

- O CH4 pretreatment & CF4 treatment
- CH, pretreatment & CF, treatment & submerged time 120 min

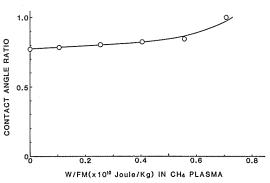


Fig. 4 The ratio of contact angle of water immersed surface/that for unimmersed surface (both CF_4 plasma treated under the identical conditions) as a function of W/FM in the pretreatment with CH_4 plasma

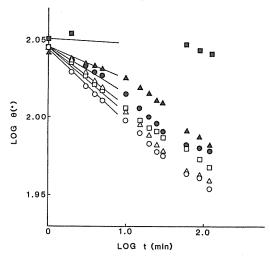


Fig. 5 Log-log plots for contact angle of water on CF₄ plasma treated Nylon 6 films and immersion time in water.

- o no CH4 pretreatment & CF4 treatment
- $^{\triangle}$ CH₄ pretreatment (M-1: W/FM 0.10 \times 10 10 J/ kg) & CF₄ treatment
- CH, pretreatment $(M-2:W/FM~0.25\times10^{10}J/kg)$ & CF, treatment
- CH₄ pretreatment (M-3:W/FM 0.40×10¹⁰ J/kg) & CF₄ treatment
- \blacktriangle CH₄ pretreatment (M-4: W/FM 0.55×10¹⁰ J/kg) & CF₄ treatment
- CH₄ pretreatment (M-5: W/FM 0.70×10¹⁰ J/kg) & CF₄ treatment

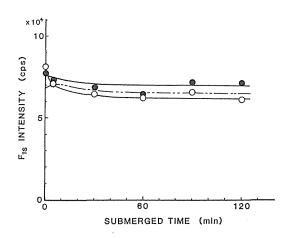


Fig. 6 Change of ESCA F_{1s} peak intensities on CF_4 plasma treated Nylon 6 films as functions of water immersion time.

- O CF4 treatment
- CH₄ pretreatment (M-4: W/FM 0.55×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment
- ---- CH₄ pretreatment (M-5:W/FM 0.70×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment

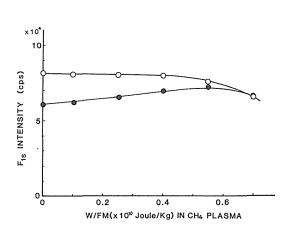


Fig. 7 ESCA F_{1s} peak intensity on unimmersed and water immersed samples of CF_4 plasma treated Nylon 6 films as functions of W/FM values of CH_4 plasma freatment.

- O CH4 pretreatment & CF4 treatment
- CH, pretreatment & CF, treatment & submerged 120min

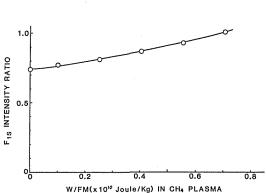


Fig. 8 The ratio of ESCA F₁₈ peak intensity of water immersed surface /that for unimmersed surface of CF₄ plasma treated Nylon 6 films as a function of W/FM in the pretreatment with CH₄ plasma

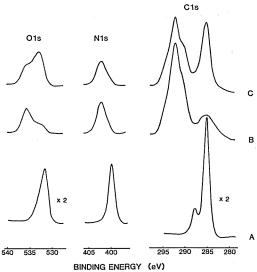


Fig. 9 Changes in ESCA signals of Nylon 6 film on CF₄ plasma treatment and subsequent water immersion.

- A: no CF4 treatment
- B: CF, treatment
- C: CF4 treatment & submerged 120min

CH4 処理したものについては、Fig.~10 に示すように、CH4 を処理することにより、(A) にみられるように、CH4 を処理することにより、(A) にみられるように、CI5 のC=Oの結合が切断され、CH2 に相当するピークが増加し、CH4 プラズマ重合膜に覆われていることをうかがわせる。本来、ナイロン 6 フィルムがもっている OI5 や NI5 ピークは消失するが、表面にラジカルができるので、空気中のO やN が結合して、新たに OI5 や NI5 ピークが現われるものと思われる。その結果、(A') のようになる。それを CF4 処理すると(B)のようになるが、水に浸漬すると(C)のように、CH2 のピークが高くなり、CI5 の F に関するピークが低くなる。

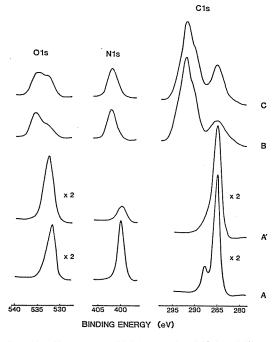


Fig. 10 Changes in ESCA signals of Nylon 6 film on CH₄ plasma pretreatment, CF₄ plasma treatment, water immersion, and the subsequent heat treatment (W/FM for the pretreatment= 0.55×10^{10} J/kg)

A: no treatment

A': CH₄ pretreatment (M-4: W/FM 0.55×10^{10} J/kg)

 $B:CH_4$ pretreatment $(M\text{-}4:W/FM~0.55\times10^{10}~J/$ kg) & CF_4 treatment

C : CH₄ pretreatment (M-4: W/FM 0.55×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment & submerged 120min

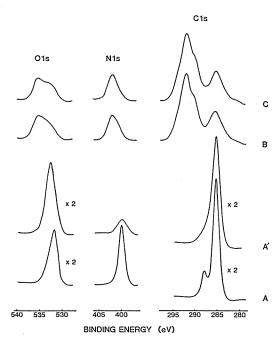


Fig. 11 Changes in ESCA signals of Nylon 6 film on CH₄ plasma pretreatment, CF₄ plasma treatment, water immersion, and the subsequent heat treatment (W/FM for the pretreatment = 0.70×10^{10} J/kg)

A: no treatment

A': CH₄ pretreatment (M-5: W/FM 0.70×10^{10} J/kg)

B : CH₄ pretreatment (M-5: W/FM 0.70×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment

C : CH₄ pretreatment (M-5: W/FM 0.70×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment & submerged 120min

しかし、Fig. 11 の ESCA シグナルをみると、水に 浸漬しても (C) スペクトルはほとんど変化しない. このことは、CH4 処理によって、表面に形成された緻密なネットワークによって、Fのついたセグメントがが部に回転やもぐり込みをすることが困難になることを示している.

4. 2. PET の場合

PET に CH_4 プラズマ処理をしていないものと,種々の W/FM の条件で CH_4 処理したものについて,ナイロンと同様に,一定条件で CF_4 処理を行って水に浸漬した場合の接触角は,Table 5 のようになる.

Table 5 Effects of CH₄ plasma polymerization on contact angle of water on CF₄ plasma treated PET films immersed in water

			Conta	ct angle (°)			
Submerged time	PET		Thickness 1	20nm	7	`hickness 60nı	n
(min)	no pretreatment	PET/M-1	PET/M-2	PET/M-3	PET/M-4	PET/M-5	PET/M-6
0	97.0	98.5	94.3	54.5	97.2	102.7	87.0
5	76.0	81.0	89.5	82.0	80.5	98.3	103.5
15		77.0	88.5	84.0	78.5	97.5	105.0
30	72.3	79.5	89.5	80.5	76.5	99.0	94.0
60	72.0	78.0	88.0	80.0	74.5	96.3	86.0
90	71.5	76.5	89.0	80.5	75.5	98.5	89.0
120	71.5	75.8	87.8	80.0	73.8	98.0	90.0
(No CF4 treatmer	nt 69.0	69.5	74.0	75.0	72.5	73.8	74.5)

4.2.1.CH₄重合膜厚さ120nm の場合の接触 角の変化

まず, CH4 重合膜の厚さ120nmの場合についてみると, Fig. 12 のように, CH4 処理をしてないものは, 水に浸漬すると接触角が低下する. しかし, CH4 処理をしたものは, 低下しにくくなる.

CH4 処理の W/FM 値の大きいものについては、図に破線で示したように異常がみられる.

Table 5 の120nm の厚さの場合について、W/FM と接触角の関係を水に浸漬する前と後についてプロットしてみると Fig. 13 のようになり、W/FM がおよそ 0.7×10^{10} J/Kg 以下では、W/FM が大きいほど水浸する前と後の接触角の値の差は小さくなるが、W/FM の著しく大きい条件で CH4 処理したものは、水に浸漬するとかえって接触角が大きくなる。このことについては後に ESCA の結果とあわせて考察する.

また,厚さ120nm について,Table 5 の水に浸漬した時間と接触角のそれぞれの値の対数をとってプロットすると,Fig. 14 のように直線関係で示され,CH4 の前処理なしのものに比べて,CH4 処理したもののほうが $\log\theta$ の値が大きくなり,また,直線の傾斜が小さくなる.この図は CH4 処理により接触角が低下したくくなることを判りやすく示している.

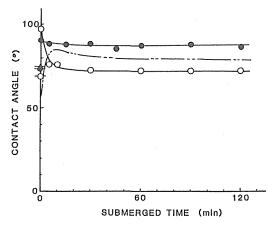


Fig. 12 Change of contact angles of water on CF₄ plasma treated PET films as functions of water immersion time (thickness of plasma polymer of methane=120nm)

- -○ no treatment, -● CH₄ pretreatment (M-2: W/FM 0.494×10¹⁰ J/kg),
- --- CH₄ pretreatment (M-3: W/FM 1.473×10^{10} J/kg)
- ---- CH₄ pretreatment (M-3: W/FM 1.473×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment

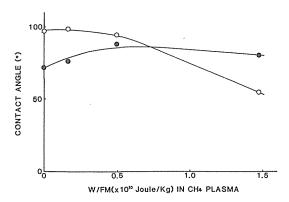


Fig. 13 Contact angles of water on unimmersed and water immersed samples of CF₄ plasma treated PET films as functions of W/FM values of CH₄ plasma pretreatment (thickness of plasma polymer of methane=120nm)

- CH₄ pretreatment (thickness: 120nm) & CF₄ treatment
- CH₄ pretreatment (thickness: 120nm) & CF₄
 treatment & submerged 120 min

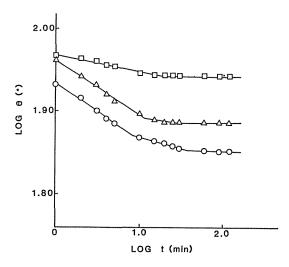


Fig. 14 Log-log plots for contact angle of water on CF, plasma treated PET films and immersion time in water (thickness of plasma polymer of methane=120nm)

- o no CH4 pretreatment & CF4 treatment
- △ CH₄ pretreatment (M-1: W/FM 0.164×10¹⁰ J/kg) & CF₄ treatment
- CH₄ pretreatment (M-2: W/FM 0.494×10¹⁰ J/kg) & CF₄ treatment

4 . 2 . 2 . CH₄重合膜厚さ 60nm の場合の接触 角の変化

CH4 重合膜の厚さを60nm にすると,次のようになる.

Fig. 15 は PET フィルムに CF4 プラズマを処理したものを、水に浸漬した時の水浸時間による接触角の変化を示しているが、 CH4 の処理をしていないの場合には、水に浸漬すると接触角が著しく低下するが、 CH4 処理をしたものは低下しにくくなる. しかし、W/FM 値の大きい場合に異常がみられることは、厚さ120nm の場合と同様である. 厚さ60nm の場合について、水に浸漬する前と後の接触角の値を W/FM に対してプロットすると、Fig. 16 のようになり、W/FM が大きいほど水浸前後の接触角の値の差が小さくなるが、W/FM の著しく大きい条件で CH4 の前処理をしたものは120nm の場合と同様に、かえって接触角が大きくなる傾向がみられる.

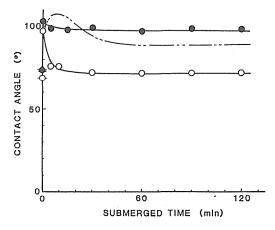


Fig. 15 Change of contact angles of water on CF₄ plasma treated PET films as functions of water immersion time (thickness of plasma polymer of methane=60nm)

- -0- no treatment, -0- CH₄ pretreatment (M-5: W/FM 0.506×10^{10} J/kg),
- CH₄ pretreatment (M-6: W/FM 1.473×10¹⁰ J/kg)
- --- CH₄ pretreatment (M-6: W/FM 1.473×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment

Table 6 I	Intensities of	ESCA F1	peaks of	f CF ₄	plasma	treated	PET	films	immersed	in	water
-----------	----------------	---------	----------	-------------------	--------	---------	-----	-------	----------	----	-------

			ESCA Fis	Intensity (ca	$s \times 10^4$))			
Submerged time	PET		Thickness 12	20nm	Thickness 60nm			
(min)	no pretreatment	PET/M-1	PET/M-2	PET/M-3	PET/M-4	PET/M-5	PET/M-6	
0	9.31	9.13	8.24	3.45	9.17	8.09	5.31	
5	6.98	6.88	6.97	6.87	7.42	6.64	6.22	
15	_	7.11	7.16	6.73	7.01	7.04	5.91	
30	5.24	6.81	6.00	6.13	6.47	6.06	6.07	
60	6.00	6.09	6.07	5.03	6.12	5.80	5.80	
90	5.32	6.00	6.04	5.14	6.58	5.71	5.76	
120	5.76	5.82	6.06	5.16	6.47	5.77	5.49	

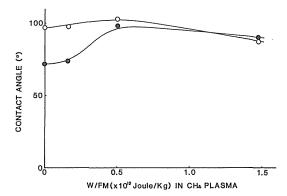


Fig. 16 Contact angles of water on unimmersed and water immersed samples of CF₄ plasma treated PET films as functions of W/FM values of CH₄ plasma pretreatment (thickness of plasma polymer of methane=60nm)

- \circ CH₄ pretreatment (thickness: 60nm) & CF₄ treatment
- CH, pretreatment (thickness: 60nm) & CF, treatment & submerged 120min

また, 厚さ60nm について, Table 5 の水に浸漬した時間と接触角の値の対数値をプロットすると, Fig. 17 のように示され, 厚さ120nm の場合 (Fig. 14) と同様の傾向がみられる.

PET の CH4 の前処理なしのものと, 種々の W/FM の条件で CH4 処理したものについて, 一定条件で CF4 処理をして水に浸漬した場合の ESCA による Fis ピークの強度の値は, Table 6 のようになる.

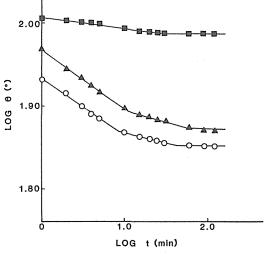


Fig. 17 Log-log plots for contact angle of water on CF₄ plasma treated PET films and immersion time in water (thickness of plasma polymer of methane=60nm)

- o no CH4 pretreatment & CF4 treatment
- A CH₄ pretreatment (M-4: W/FM 0.161×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment
- $^{\bullet}$ CH₄ pretreatment (M-5: W/FM 0.506×10^{10} J/ kg) & CF₄ treatment

4. 2. 3. CH₄重合膜厚さ120nmの場合の ESCAシグナル

CH4 の前処理をしていないものと CH4 を処理をし

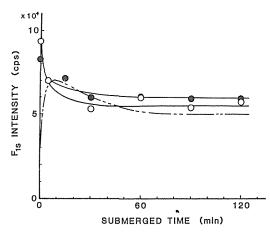


Fig. 18 Change of ESCA F_{ls} peak intensity on CF_4 plasma treated PET films as functions of water immersion time (thickness of plasma polymer of methane=120nm)

O CF4 treatment

CH₄ pretreatment (M-2: W/FM 0.494×10¹⁰ J/kg) & CF₄ treatment

---- CH₄ pretreatment (M-3 : W/FM 1.473×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment

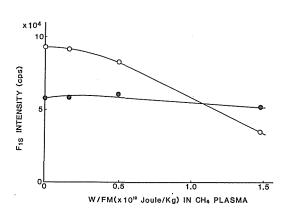


Fig. 19 ESCA F_{Is} peak intensities on unimmersed and water immersed samples of CF₄ plasma treated PET films as functions of W/FM values of CH₄ plasma pretreatment (thickness of plasma polymer of methane=120um)

O CH4 pretreatment (thickness: 120nm) & CF4 treatment

 CH₄ pretreatment (thickness: 120nm) & CF₄ treatment & submerged 120min たものについて CF4 処理をして、 F_{1s} ピークの高さを 水に浸漬した時間に対してプロットすると、 F_{1s} 18 のようになり、水に浸漬すると F_{1s} ピークが低くなることがわかる。しかし、CH4 処理したものは低下しにくくなる。CH4 処理の W/FM の大きいものについては、図に破線で示したように、異常がみられる。

以上の結果をまとめて、W/FM 値に対して水に浸漬する前後の F_{1s} の高さをプロットしてみると、 F_{1g} . 19 のようになり W/FM が大きくなると下が結合しにくくなり、 F_{1s} の値は低下するが、水に浸漬した時の値は W/FM にかかわらず、あまり差が認められない。

 C_{1s} , O_{1s} の ESCA プロフィールは Fig. 20, 21 に みられるように, CH4 の前処理をしていないもの (A) も, CH4 処理をしたもの (A') も, CF4 処理に よって (B), CH2 の高さが低くなり, Fに関するピークが現れ, それを水に浸漬すると (C), CH2 の高さが 増し, Fに関するピークが低くなる.

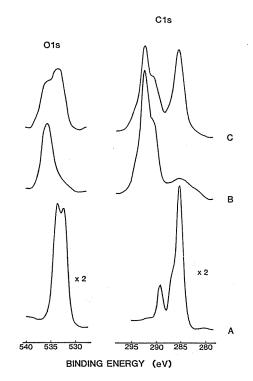


Fig. 20 Changes in ESCA signals of PET films due to the treatments (without pretreatment)

A: no CF_4 treatment

B: CF4 treatment

C: CF4 treatment & submerged 120min

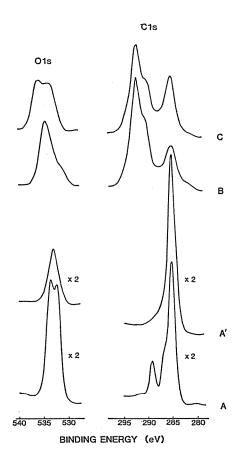


Fig. 21 Changes in ESCA signals of PET films due to the treatments (pretreatment conditions: $W/FM=0.494\times10^{10}$ J/kg, thickness=120nm)

A : no treatment

A': CH₄ pretreatment (M-2: W/FM 0.494×10¹⁰ J/kg)

B : CH₄ pretreatment (M-2 W/FM 0.494×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment

C : CH₄ pretreatment (M-2 : W/FM 0.494×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment & submerged 120min

しかし、Fig. 22 にみられるように W/FM の著しく 大きい条件で CH_4 処理をした場合には、 CH_2 が Fig. 21 に比べて大きい値となり(B)、水に浸漬するとか えって Fに関するピークが高くなる(C).

4 . 2 . 4 . CH₄重合膜厚さ60nmの場合の ESCAシグナル

CH4 の前処理をしないものと CH4 処理をしたもの

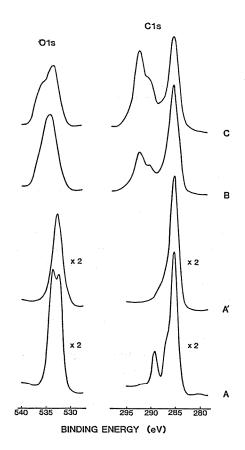


Fig. 22 Changes in ESCA signals of PET films due to the treatments (pretreatment conditions: $W/FM=1.473\times10^{10}$ J/kg, thickness=120nm)

A : no treatment

A': CH₄ pretreatment (M-3: W/FM 1.473×10¹⁰ J/kg)

B : CH₄ pretreatment (M-3 : W/FM 1.473 \times 10 10 J/kg) & CF₄ treatment

C: CH₄ pretreatment (M-3: W/FM 1.473×10¹⁰ J/kg) & CF₄ treatment & submerged 90min

に、CF4 処理をした場合の F1s ピークの高さを水に浸漬した時間についてプロットすると、F1g 23 のようになる。

厚さ60nm のときの F_{1s} について結果をまとめると、 F_{1s} 24 のようになる。W/FM が大きくなると、 F_{1s} が結合しにくくなり、 F_{1s} の値は低下するが、水に浸漬したときの F_{1s} の強度は、W/FM にかかわらず

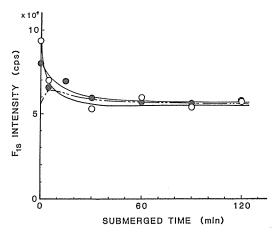


Fig. 23 Change of ESCA $F_{\rm Is}$ peak intensity of CF_4 plasma treated PET films as functions of water immersion time (thickness of plasma polymer of methane=60nm)

- o CF4 treatment
- CH₄ pretreatment (M-5: W/FM 0.506×10¹⁰ J/kg) & CF₄ treatment
- --- CH₄ pretreatment (M-6: W/FM $1.473 \times 10_{10}$ J/kg) & CF₄ treatment

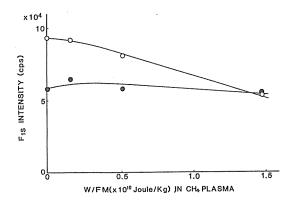


Fig. 24 ESCA F_{ls} peak intensities on unimmersed and water immersed samples of CF₄ plasma treated PET films as functions of W/FM values of CH₄ plasma pretreatment (thickness of plasma polymer of methane=60nm)

- CH₄ pretreatment (thickness: 60nm) & CF₄ treatment
- CH₄ pretreatment (thickness: 60nm) & CF₄ treatment & submerged 120min

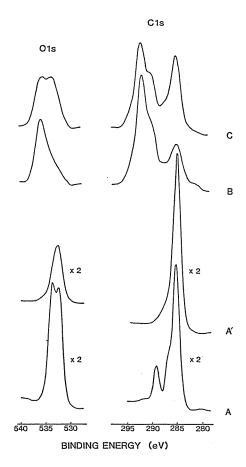


Fig. 25 Changes in ESCA signals of PET films due to the treatments (pretreatment conditions: W/FM 0.506×10^{10} J/kg, thickness=60nm)

A: no treatment

A': CH₄ pretreatment (M-5: W/FM 0.506×10^{10} J/kg)

B : CH₄ pretreatment (M-5 : W/FM 0.506×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment

C: CH₄ pretreatment (M-5: W/FM 0.506×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment & submerged 120min)

ほぼ一定となっている.

厚さ60nm については、 C_{1s} , O_{1s} の ESCA のプロフィールをみると、 F_{1g} . 25、26 に示すように、 CF_{4} 処理によって(B)、 CH_{2} の強度が低下し、F との結合ピークが現れるが、それを水に浸漬すると(C)、 CH_{2} の強度が増し、F との結合ピークが低くなる。

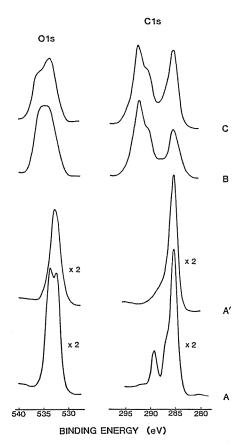


Fig. 26 Changes in ESCA signals of PET films due to treatments (pretreatment conditions: W/ $FM=1.473\times10^{10}$ J/kg, thickness=60nm)

A : no treatment

A': CH₄ pretreatment (M-6: W/FM 1.473×10^{10} J/ kg)

B : CH₄ pretreatment (M-6 : W/FM 1.473×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment

C: CH₄ pretreatment (M-6: W/FM 1.473×10¹⁰ J/kg) & CF₄ treatment & submerged 90min

4. 2. 5. W/FM が著しく大きく, CH4 重合 膜の厚さが厚い場合の ESCA プロフィール

PET の CH4 プラズマ処理をしたときの重合膜の厚さが厚く, W/FM の大きい値の場合は, W/FM 値の小さい場合に比べて異なった ESCA スペクトルを与えることがわかった.

Fig. 27 は、CH4 処理をしないものに CF4 プラズマ

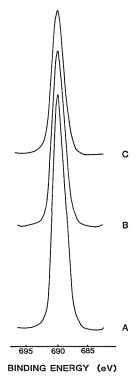


Fig. 27 ESCA F_{ls} signals of CF_4 plasma treated PET without pretreatment

A: CF4 treatment

B: CF₄ treatment & submerged 5min C: CF₄ treatment & submerged 120min

処理をした場合の Fis ピークであるが, CF4 プラズマ 処理によって高いピークを示し(A), それを水に浸 漬するとピーク強度は減少する(B,C)が, プロ フィールは同様であることを示している.

しかし、CH4 処理の厚さが $60\,\mathrm{nm}$ (W/FM=1.473) の場合は、Fig.~28 のように、CF4 プラズマによって、F1s ピークの右側にショルダーが現われる(A). 水に浸漬すると、このピークはいったん強くなり(B)、さらに長時間浸漬すると低下する(C). ところが、Fig.~29 は、CH4 処理の厚さが $120\,\mathrm{nm}$ (W/FM=1.473) で極端に大きい場合であるが、F1s に2つのピークがみられる。このうち、左のピークは、5分間水に浸漬した場合はかえって強度を増すが(B)、長時間水に浸漬するとかえって強度が低下していることがわかる。

このように、CH4 処理で重合膜が厚く W/FM 値の

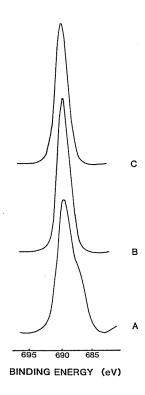


Fig. 28 ESCA F_{1s} signals of CF4 plasma treated PET with methane plasma pretreatment (plasma polymorization of methane : W/FM=1.473 $\times\,10^{10}$ J/kg, thickness=60nm)

A : CH4 pretreatment (M-6 : W/FM 1.473 \times 10 10 J/ kg) & CF4 treatment

 $B: CH_4$ pretreatment (M-6: W/FM $1.473\times 10^{10}~J/$ kg) & CF4 treatment & submerged 5min

C : CH4 pretreatment (M-6 : W/FM 1.473×10^{10} J/ kg) & CF4 treatment & submerged 90min

著しく大きいときに、 F_{1s} が 2つのピークに分かれ、かつ、水に浸漬すると、ピーク強度がいったん高くなって低下する現象については、 F_{1g} . 22 のように、 C_{1s} ピークにも異常がみられ、今後の検討が必要である。

4.2.6.CH4 処理の効果

種々の W/FM の条件で、CH4 処理をしたものに同一条件で CF4 処理をして、それを水に浸漬したときに、接触角や ESCA の F_{1s} ピーク強度がどの様に変

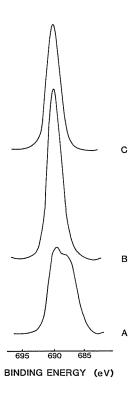


Fig. 29 ESCA F_{ls} signals of CF_4 plasma treated PET with methane plasma pretreatment (plasma polymerization of methane : W/FM=1.473×10¹⁰ J/kg, thickness=120nm)

A : CH₄ pretreatment (M-3 : W/FM 1.473×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment

B : CH4 pretreatment (M-3 : W/FM 1.473×10^{10} J/ kg) & CF4 treatment & submerged 5min

C: CH₄ pretreatment (M-3: W/FM 1.473×10^{10} J/kg) & CF₄ treatment & submerged 90min

化するかをまとめるために、水に浸漬する前後のそれらの値の比をとって、W/FM 値に対してプロットしてみると、Fig. 30、31 のように、 CH_4 処理の W/FM の値が大きいほど、また厚さが厚いほど、その比が大きくなり、 CH_4 によるネットワークが表面分子の回転またはもぐりこみを妨げる効果のあることがうかがえる.

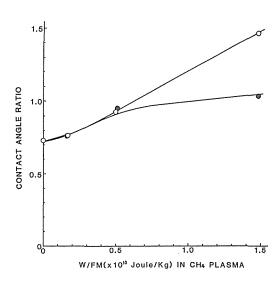


Fig. 30 The ratio of contact angles of water (after water immersion/before) as functions of W/FM: in plasma polymerization of methane

o thickness: 120nm, thickness: 60nm

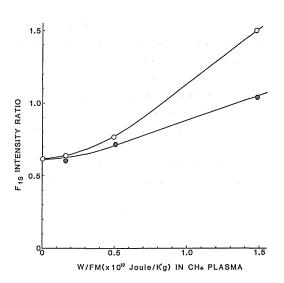


Fig. 31 The ratio of ESCA F_{ls} peak intensity (after water immersion/before) as functions of W/FM in plasma polymerization of methane

o thickness: 120nm, • thickness: 60nm

プラズマポリマーの物理的特性は W/FM によるところが大きい. CF4 プラズマ処理フィルムの表面力学上の性質は、CH4 プラズマの前処理の処理条件によって影響される. Fig. 32 は,先に示した接触角の対数値と水浸時間の対数値のグラフの,初期の直線の傾きから計算したものである. ここで水浸によるFの減少値Ks は, $At=Aot^{-k}$ によって与えられる. この図にみられるように,W/FM の値が大きくなるにしたがって高いバリヤー特性を示している.

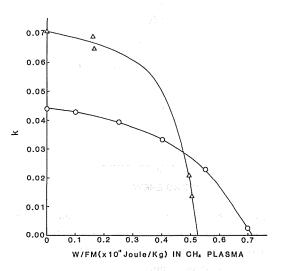


Fig. 32 Effect of the pretreatment condition on th decay rate constant, k, for Nylon 6 and PET films subsequently treated by CF_4 plasma

O Nylon 6, A PET

結 論

ナイロン6フィルムおよび PET フィルムについて、CH4の前処理なしのもの、および CH4で前処理したものについて、CF4プラズマ処理を行って、その試料を一定時間水に浸漬することによって、接触角やESCA測定結果がどの様に変化するかを検討した。一般に水に浸漬することによって、接触角および表面の下は低下し、一定時間以上の浸漬によって平衡値に達する。CH4処理したものは、表面にネットワークが形成されるため、さらにCF4処理をしてそれを水に浸漬

した場合も、変化が少なくなることが明らかになった。このような実験によって得られた事実は、材料表面のフッ素原子が内部に廻り込むとの考えを支持する結果となった。

なお,本研究の一部については, Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 26, 2061-2074 (1988) に発表した.

本研究に際し、御協力下さいました深山雅代助手、 澤裕子助手にお礼申し上げます.

文 献

- T. Yasuda, T. Okuno, K. Yosida, and H. Yasuda, J. Polym. Sci. Polym. Phys. Ed., 26, 1781 (1988)
- 2. 安田 武, 奥野温子, 吉田恭子, 山本康代, 深山雅代, 安田弘次, 武庫川女子大学紀要, 被服学科編, 36, 23 (1988)
- 3 . H. Yaslda, A. K. Sharma, and T. Yasuda, J. Polym. Sci. Poiym. Phys. Ed. 19, 1285 (1981) (1989年9月27日受理)